기술사
 제 82 회
 제 1 교시 (시험시간: 100 분)

 분
 자격
 수험
 성

 야
 금 속
 종목
 표면처리기술사
 번호
 명

※ 다음 문제중 10 문제를 선택하여 설명하시오. (각 10 점)

- 1. 일반적으로 PCB 기판에 스루홀(Through Hole)을 기계 또는 레이져 드릴(Drill) 가공한 뒤에 무전해 Cu 도금을 실시한다. 무전해도금 이전에 디스미어(Desmear)공정이 존재하는 데, 습식 디스미어 공정의 목적과 기본적인 디스미어 주요 공정 프로세스 3 가지를 순서대로 설명하시오.(단, 수세공정은 생략)
- 2. 약품 투입방법에 의한 시안계 폐수처리시 악취발생의 원인으로 부정확한 약품의 투입이 원인이 되고 있다. 이와 관련하여 알칼리염소처리 방법에 의한 시안계 폐수 처리에 대하여 설명하시오.
- 3. 물리적 기상증착(Physical Vapor Deposition, PVD) 과정 중 박막 형성은 3 단계에 의해 이루어진다. 박막형성의 3 단계에 대하여 설명하시오.
- 4. 표면처리 제품관리에서 외관검사에 대하여 범위 및 항목을 설명하시오.
- 5. 비평형플라즈마와 평형플라즈마 차이점을 설명하고, 박막코팅 및 표면세정(Cleaning) 시에 비평형플라즈마 만이 적용될 수 있는 이유를 설명하시오.
- 6. 플라즈마 화학증착(PECVD)시 박막의 접착력을 향상시키기 위한 4 가지 방법을 예를 들고 설명하시오.

기술사 제 82 회 제 1 교시 (시험시간: 100 분)

| 분 | 7.4 | 자격 | ᄑᄖᅯᅴᆌᄼᄮ | 수험 | 성 | |
|---|-----|----|---------|----|---|--|
| 야 | 금 속 | 종목 | 표먼저리기술사 | 번호 | 명 | |

- 7. 전해탈지는 여러 탈지공정중에 마무리 탈지공정으로 사용된다. 전해탈지는 음극 탈지와 양극탈지로 구별되는 데, 소재에 따라 결정이 된다. 다음의 소재는 음극 탈지와 양극탈지 중에서 어떤 것이 유리하며 그 이유는 무엇인가?
- 1) 철재 볼트 2) 알루미늄 제품 3)아연 다이캐스팅 제품
- 4) 스테인리스 강판 5) 황동제품
- 8. 습식전기도금의 분해전압(分解電壓)에 대해서 설명하시오.
- 9. 이온빔 에칭기술은 전자빔 에칭기술에 비해 장점들을 갖고 있다. 이 장점들을 두 가 지만 열거하고 이를 간략히 설명하시오.
- 10. 음극방식과 양극방식의 원리를 설명하시오.
- 11. 전자파 차폐용으로 황산욕에서 Cu 전기도금을 시행하려고 한다. 가로 5cm, 세로 10cm 의 제품에 대해 전류 0.5A 로 60 분 한 면에만 도금하였다. 얻어지는 도금 두께 를 때로 계산하라. (숫자는 소수점 이하 반올림하여 표기)

(단, Cu 도금의 전류효율은 98%로 가정하고 계산에 필요한 값은 아래와 같다.)

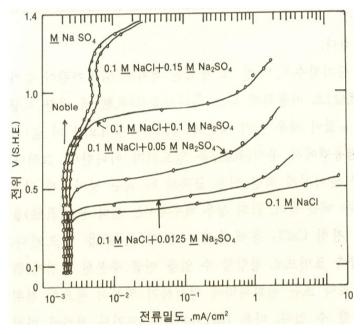
Cu 분자량 = 63.546 Cu 밀도 = 8.92 g/cm Faraday 상수 = 96485

기술사 제 82 회

제 1 교시 (시험시간: 100분)

| 분 | 7.4 | 자격 | ᄑᄜᆌᆌᆁᄉᆡ | 수험 | 성 | |
|---|-----|----|---------|----|---|--|
| 야 | 古名 | 종목 | 표먼저리기물사 | 번호 | 명 | |

12. 다음의 그림은 0.1M NaCl 용액에서의 18-8 Stainless 강의 25℃에서의 정전압 분극 곡선을 나타낸 것이다. 가장 부식이 잘 일어난 경우를 고르고 그런 판단의 근거에 대해설명하시오.



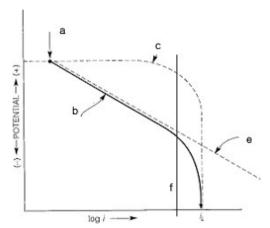
13. 습식표면처리 기술 중 가장 많이 쉽게 이용되고 있는 니켈 전기도금액의 기본 성분 중 붕산(H3BO4)의 역할에 대해 기술하시오.

기술사 제 82 회 제 2 교시 (시험시간: 100 분)

| 분 | 7 4 | 자격 | ㅠ머ㅋ니기스니 | 수험 | 성 | |
|---|-----|----|----------------|----|---|--|
| 야 | 古 等 | 종목 | 표먼저디기술사 | 번호 | 명 | |

※ 다음 문제중 4 문제를 선택하여 설명하시오. (각 25 점)

- 1. 고탄소강 부품의 녹 제거에 염산을 사용하고 있는데 산세에 의해서 수소취성을 받게 되므로 산세하는 부품이 경도(硬度)한계(限界) 이상인 경우 대책을 적고, 산세 후 산성도금욕과 알칼리 도금욕에서 도금할 경우, 수소취성에 대한 각각의 대책을 기술하시오.
- 2. 다음 그림에서 b 곡선(실선)은 혼합분극의 상태를 나타낸 그림이다. f 라는 전류밀도로 전극에 전류를 흘려주었을 때 이 전극에 걸리는 활성화분극과 농도분극의 크기는 각각 어떻게 정할 수 있는지 설명하시오.

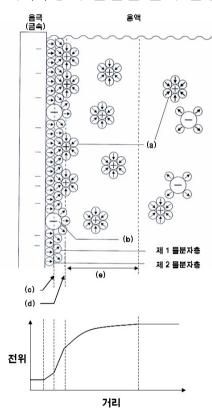


3. 무전해도금은 치환도금, 환원도금으로 크게 분류할 수 있다. 치환도금, 환원도금의 원리를 간략히 서술하고 그 방식을 적용한 실제 도금 사례를 한 가지씩 제시하시오. 또한 무전해도금의 장단점을 전기도금과 비교하여 설명하시오. (장점, 단점 별 3 가지씩 기술하시오.)

기술사 제 82 회 제 2 교시 (시험시간: 100 분)

| | 1 1 -1 | | | _ ' \ | 10 1C: 144 C/ | | |
|---|--------|----|---------|-------|---------------|---|--|
| 분 | 7.4 | 자격 | ᄑᄜᆌᆌᆌᄉᆝ | 수험 | | 성 | |
| 야 | 금 속 | 종목 | 표면처리기술사 | 번호 | | 명 | |

- 4. 다음은 전기이중층의 Stern-Graham 모델이다. 다음에 답하시오.
 - 가. 그림에 표기된 (a)~(e)의 명칭을 쓰시오.
 - 나. 그림 (가)의 (d)층과 관련된 분극 현상을 설명하시오.
 - 다. 그림 (가)의 (e)층과 관련된 분극 현상을 설명하시오.



기술사 제 82 회 제 2 교시 (시험시간: 100 분)

| 분 | J & | 자격 | ᄑᄜᅴᆌᆁᄉᆡ | 수험 | 성 | |
|---|-----|----|---------|----|---|--|
| 야 | 古 等 | 종목 | 표면처리기술사 | 번호 | 명 | |

- 5. 무전해 Ni-P 도금과 무전해 Ni-B 도금 형성과정 및 형성된 피막의 특성에 대하여 설명하시오.
- 6. 도금 생산성은 도금속도에 의해 가장 크게 좌우되고, 전기도금의 경우에 도금속도 는한계전류밀도에 의해 제약을 받게 된다. 한계전류밀도의 정의와 한계전류밀도에 영향을 주는 인자들에 대해 기술하고 그를 기반으로 한계전류밀도를 높일 수 있는 대책들을 5가지 이상 기술하시오.

기술사 제 82 회

제 3 교시 (시험시간: 100분)

| 분 | 그 소 | 자격 | 표면처리기술사 | 수험 | 성 | |
|---|-----|----|---------|----|---|--|
| 야 | 古等 | 종목 | 표면서디기물자 | 번호 | 명 | |

※ 다음 문제중 4 문제를 선택하여 설명하시오. (각 25 점)

- 1. 크롬계 폐수를 처리할 수 있는 방법들을 나열하고, 이러한 방법들에 대해 간략히 설명하시오.
- 2. 이온플레이팅(Ion Plating)의 원리, 장치개략도, 공정제어 방식 및 응용분야에 대하여 설명하시오.
- 3. 최근들어 반도체 공정에서 집적도가 증가함에 따라 Gate Oxide 를 형성하는 데 있어서 ALD(Atomic layer deposition) 공법을 적용하고 있다.
 - 1) ALD 공법에 대하여 정의하고,
 - 2) 박막 형성 공정을 도식화하여 설명하고,
 - 3) 일반적인 CVD 공법과 비교하여 ALD 공법의 장점을 2 가지 이상 열거하시오.
- 4. 금속용사법의 일반적인 장단점을 설명한 후, 열용사법과 플라즈마용사법의 원리 및 특징을 각각 설명하시오.
- 5. R.F 스팟터링법에 의한 증착과정 중에 비금속 타겟이 양이온들에 의해 이온 스팟 터링 될 수 있는 이유를 설명하시오.
- 6. CVD 증착과정 중 공정조건인 온도 ,압력 및 기체의 장입속도가 각기 어떤 상태 일 때 Boundary Layer 두께가 두꺼워지는 가를 설명하고, 이 상태에서 막의 성장속도를 율속하는 요인은 무엇인가를 설명하시오.

기술사 제 82 회 제 4 교시 (시험시간: 100 분)

| 분 | | 자격 | ᄑᄜᆌᆌᆌᄼᆡ | 수험 | 성 | |
|---|----|----|---------|----|---|--|
| 야 | 古书 | 종목 | 표면처리기술사 | 번호 | 명 | |

※ 다음 문제중 4 문제를 선택하여 설명하시오. (각 25 점)

- 1. 박막공정기술이 산업계에 많이 활용됨에 따라 이에 대한 표면분석기술의 활용도가 높아지고 있는 상황이다. 또한 표면처리 분야의 활용도를 극대화하고 산업체의 현장 문제를 해결하고자 한다면 표면분석기술의 종류 및 활용방안은 기본적으로 알고 있어야 된다고 판단된다. 박막의 표면분석을 위한 분석장비 중 표면의 화학적 조성 및 결합 상태를 분석하는 Auger 전자분광법(AES), X-선전자분광법(XPS)에 대해 간략히 설명하시오.
- 2. 스테인리스강의 응력부식균열(Stress Corrosion Cracking)에 대하여 설명하고, 그 방지대책은 무엇인지 설명하시오.
- 3. 부식의 종류에 대하여 5 가지 이상 열거하고, 각각에 대해 설명하시오.
- 4. 수용액 중에서 금속의 부동태(Passivation)현상 및 이를 활용한 방식방법(Corrosion Protection)의 적용 사례를 예시하여 설명하시오.
- 5. 10mm 두께의 304 스테인리스강판을 용접하여 제품을 만들려고 한다. 용접부위에서 발생하는 부식 현상에 대하여 설명하고 방지대책을 설명하시오.

기술사 제 82 회 제 4 교시 (시험시간: 100 분)

| | | | | | · - · / - / / / - / - / / / / - / | | |
|---|-----|----|---------|----|---|---|--|
| 분 | 7.4 | 자격 | ᄑᄜᆗᄀᄀᄼᄓ | 수험 | | 성 | |
| 야 | 금 속 | 종목 | 표면처리기술사 | 번호 | | 명 | |

- 6. 금속의 수용액에서 부식반응이 발생할 경우, 양극반응과 음극반응이 동시에 일어나며, 음극반응을 억제하면 부식은 진행되지 않게 된다. 철을 예로 들면, 양극반응은 철이용해되는 반응, 즉, Fe → Fe²⁺ + 2e⁻ 이다. 다음의 경우 철의 부식반응에 짝을 이루는음극반응을 반응식과 함께 쓰시오.(각 5 점)
 - 가. 밀폐된 1M 황산 탱크용액에서의 철 부식
 - 나. pH 5 인 바닷물 속에서 철 부식
 - 다. 산성 동도금 용액에서 철 부식
 - 라. 0.1M HNO3 용액에서 철 부식
 - 마. 공기 교반이 되고 있는 0.1M 황산용액에서 철 부식